

# マイクロデバイス製造関連装置 Micro Device Exposure Systems

マイクロデバイス製造関連装置

## 片面マスクアライナー Single-Sided Exposure Systems



本装置は、半導体デバイス、各種センサーをはじめ、多様なデバイス分野での露光工程に用いられます。研究開発から、小・中ロット製造用に最適です。

光源は250W～5kW。露光サイズはφ200mmまで取り揃えております。

### ■UPE-20002LU仕様

光学性能	
光源	250W 超高压水銀ランプ
露光主波長	g, h, i 3波長
有効露光サイズ	φ200mm (□140mm)
初期照度	6mW/cm <sup>2</sup> 以上 at365nm (露光面中心)
照度分布	±5% (有効露光サイズ内9点測定)
コリメーション角	1.8° (半角)
露光量制御	積算光量制御
制御方式	タイマー or 積算光量計



## オートアライナー装置 Auto Alignment Single-Sided Exposure Systems



本装置はカセットtoカセット搬送システムを搭載した全自動全面一括露光装置です。多様なデバイスの量産用アライナーとして、ローダー、アンローダー搬送システムを構築し、生産量をアップします。

### ■UPE-09002AWT仕様

光学性能	
光源	250W 超高压水銀ランプ2灯
露光主波長	g, h, i 3波長
有効露光サイズ	φ75mm
初期照度	40mW/cm <sup>2</sup> 以上 at365nm (露光面中心)
照度分布	±5%以内 (有効露光サイズ内9点測定)
露光量制御	積算光量制御

# 両面マスクアライナー Double-sided Exposure Systems

## 両面マスクアライナー Double-sided Exposure Systems



両面マスクアライナー

本装置はウェハー、ガラス基板などのフォトリソ工程において、ガラスマスクとワークをアライメントし、板上にコーティングされたフォトレジストにプロキシミティ及びソフトコンタクト露光にて、微細なマスクパターンを転写するマスクアライナーです。

また、本装置は両面アライメントを行い、プロキシミティ及びソフトコンタクト露光が可能です。ガラスマスクとワークのアライメントはモニタ画像を観察しながら手動操作にて行ないます。

### ■UPE-2001ORLU仕様

光学性能	
光源	1kW 超高压水銀ランプ
露光主波長	g, h, i 3波長
有効露光サイズ	φ200mm
初期照度	15mW/cm <sup>2</sup> at365nm (露光面中心)
照度分布	±5%以内 (有効露光サイズ内9点測定)
露光量制御	積算光量制御